**B14** 

## METHOD AND DEVICE FOR ELECTRICALLY BORING HOLE

Patent Number:

JP2131585

Publication date:

1990-05-21

Inventor(s):

ITO HIROYASU

Applicant(s):

HAMAMATSU PHOTONICS KK

Requested Patent:

☐ JP2131585

Application Number: JP19880284178 19881110

Priority Number(s):

IPC Classification:

C12N15/87; C12M1/00; C12N13/00

EC Classification:

Equivalents:

JP1955260C, JP6087783B

### **Abstract**

PURPOSE: To selectively and readily take a taking-in material in a specific site of a cell by positioning a taking-in part of cell on either one side of direction of line of electric force, heating a cell part on other side and applying direct current pulse electric field in providing small hole for taking-in material in the cell by an electrically boring method.

CONSTITUTION: A medium liquid 17 containing a cell 16 is put in a recessed part 11 formed in the central part of a substrate 11 and DNA taking-in part of the cell 16 is positioned on one side in the direction of line of electric force by a method rotating and moving the substrate 11 while observing using an optical microscope 3. Then a part of cell 16 on other side in the direction of line of electric force is irradiated with laser beam L1 from laser light source 4 and selectively heated. At the same time, electricity is sent to electrodes 13a and 13b from a direct current pulse electric source 2 and direct current pulse electric field is applied to the medium liquid 17 to form small holes. Thereby DNA, etc., is taken in from the small holes for a long period, since repair of small holes in unheated position of cell 16 is slow.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ② 公 開 特 許 公 報(A) 平2

平2-131585

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)5月21日

C 12 N 15/87 C 12 M 1/00 C 12 N 13/00

B 8717-4B 7329-4B

8717-4B C

C 12 N 15/00 審査請求 未請求 請求項の数 7

A 7 (全6頁)

60発明の名称

細胞電気穿孔法および装置

②特 顧 昭63-284178

②出 願 昭63(1988)11月10日

個発明者 伊藤

博 康

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会

补内

の出 願 人 浜松ホトニクス株式会

静岡県浜松市市野町1126番地の1

社

個代 理 人 弁理士 長谷川 芳樹 :

外3名

明 細 書

1. 発明の名称

和胎電気穿孔法および装置

## 2. 特許請求の範囲

1. 媒液中に含まれた細胞の細胞膜に直流パルス電場を印加することで小孔を形成し、この小孔を介して前記媒液中にあらかじめ含まれている被取込物を前記細胞中の取込部分に取り込む細胞電気穿孔法において、

前記直流パルス電場の電気力線方向の一方側に前記細胞の取込部分を位置せしめる第1のステップと、

前記電気力級方向の他方側の前記細胞部分を選択的に加熱すると共に、前記直流パルス電場を印加する第2のステップとを備えることを特徴とする細胞電気穿孔法。

前記細胞はあらかじめ染色され、前記第
のステップは前記電気力線方向の他方側の細胞

部分を選択的にレーザ光照射して加熱することを 特徴とする請求項 1 記載の細胞電気穿孔法。

- 3. 前記電気力線方向の他方側の細胞部分はあらかじめ染色され、前記第2のステップは前記細胞全体をレーザ光照射して前記染色部分を加熱することを特徴とする請求項1記載の細胞電気穿孔法。
- 4. 媒液中に含まれた複数の細胞の細胞膜に 直流パルス電場を印加することで小孔を形成し、 この小孔を介して前記複数の細胞中の所定の細胞 に前記媒液中にあらかじめ含まれた被取込物を取 りむ細胞電気穿孔法において、

前記所定の細胞以外の細胞を選択的に加熱する と共に、前記直流パルス電場を印加するステップ を確えることを特徴とする細胞電気穿孔法。

- 5. 前記選択的な加熱は、前記所定の細胞以外の細胞を選択的にレーザ光照射することにより行なうことを特徴とする請求項4記載の細胞唯気穿孔法。
  - 6. 前記選択的な加熱は、前記所定の細胞以

外の細胞を選択的に染色してレーザ光照射するこ とにより行なうことを特徴とする請求項4記載の 枷胞呕気穿孔法。

7. 細胞を含む媒液を入れるための凹部が形 成され、かつ前記媒液に電場を印加するための一 対の電極が前記凹部に設けられた基体と、

前記一対の電極に直流パルス電圧を印加するた めの世級手段と、

前記基体の凹部に入れられた媒液中の細胞を観 察するための顕微鏡と、

前記基体の凹部に入れられた媒液中の細胞を加 熱するためのレーザ光顔とを崩えることを特徴と する細胞電気穿孔装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

3

[産業上の利用分野]

本発明は細胞を含む媒液に高圧パルス電場を印 加し、細胞膜に小孔を形成することによって DNAなどを細胞中に取り込む細胞電気穿孔法と、 これに用いられる細胞電気穿孔装置に関するもの

中止すれば小孔は修復される。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、電気穿孔法による場合には、原 則として直流パルス電場中の全ての細胞の細胞膜 に小孔が形成されるため、多数の細胞中の特定の 細胞のみに D N A を取り込ませることはできない。」他方側の細胞部分を選択的にレーザビームなどで また、この小孔は直流パルス電場の電気力線方向 の一方および他方の端部に等しく形成されるので、 1個の細胞の特定の部位、例えば細胞の核あるい はこの近傍にのみDNAを収り込ませることは困 難である。

そこで本発明は、媒液中の複数の細胞中の特定 の細胞あるいは1個の細胞の特定の部位にのみ、 DNAの如き被取込物を取り込むことのできる細 胞電気穿孔法と、このために用いられる装置を提 供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明に係る細胞電気穿孔法は、媒液中に含ま れた細胞の細胞膜に直流パルス電場を印加するこ とで小孔を形成し、この小孔を介して媒液中にあ

である。

[従来の技術]

バイオテクノロジーの進展に伴ない、細胞中に DNAなどの彼取込物を取り込むことが重要にな っている。このような操作を行なうためには、細 胞膜に小孔を形成することが必要になるが、この 技術の第1のものとして、レーザ光による穿孔法 である。これは、細胞の特定の部位にレーザビー ムを照射して加熱し、細胞膜に小孔を形成するも のがある。これによれば、DNAはこの小孔を介 して細胞中に取り込まれることになるが、この方 法では小孔は加熱形成されるため、細胞膜が傷つ きやすく、DNAの取り込み後も小孔が残存する ことになる。

これに対して、従来技術の第2のものとしての 電気穿孔法によれば、細胞を含む媒液に直流パル ス哉場を印加することにより細胞膜に小孔が形成 され、この小孔を介してDNAなどが取り込まれ る。この電気穿孔法によれば細胞膜が特に傷つけ られることがなく、また直流パルス電場の印加を

らかじめ含まれているDNAなどの被取込物を前 記細胞中の収込部分に取り込む細胞電気穿孔法に おいて、直流パルス電場の電気力線方向の一方側 に細胞の取込部分(例えば核の近傍部分)を位置 せしめる第1のステップと、上記電気力線方向の 加熱すると共に、直流パルス電場を印加する第2 のステップとを備えることを特徴とする。

また、本発明に係る細胞電気穿孔法は、媒液中 に拒数の細胞が含まれている場合において、直流 パルス或場を印加することで形成した小孔を介し て複数の細胞中の所定の細胞に被収込物を取りむ に際し、上記所定の細胞以外の細胞をレーザビー ムなどで選択的に加熱すると共に、直流パルス低 場を印加するステップを備えることを特徴として もよい。

さらに、本苑明に係る細胞で気穿孔装置は、細 胎を含む媒液を入れるための凹部が形成され、か つ媒液に電場を印加するための一対の電極が凹部 に設けられた基体と、上記の一対の電極に直流パ ルス 起圧を印加する 超級と、 基体の 凹部に入れられた 媒液中の 細胞を 観察する ための 顕微鏡と、 基 基体の 凹部に入れられた 媒液中の 細胞 加熱する ための レーザ光級とを 備えることを特徴とする。 (作用)

1 7 中の細胞 1 6 に照射されるようになっている。 一方、 甚体 1 の下方にはリレーレンズ 5 を介して 白色光版 6 が設けられ、ここからの光は細胞 1 6 を通って光学顕微鏡 3 で拡大され、観察者 7 に観 窓光 L 2 として届くようになっている。 なお、図 中の M は全反射ミラーであり、 B S はピームスプ リックである。

次に、第3図により上記実施例の作用を説明する

第3図において、図示しない媒液中に含まれた 細胞16は彼16aを有しているものとする。い ま、第3図の状態で電極13a,13bの間に直 流パルス電場を印加すると、細胞16の電気力線 方向の一方および他方側の端部P<sub>1</sub>,P<sub>2</sub>に、電 気穿孔による小孔が形成される。この小孔は、直 流パルス電場を加えることで開状態となり、直流 パルス電場を解除すると修復していく。

ところで、この小孔の形成および修復速度は、 その部分の温度により異なり、高温のときには形 成および修復が共に速くなり、低温のときには形 (実施例)

以下、添付図面を参照して、本発明の実施例を説明する。

第1 図は本発明に係る細胞地気穿孔法の実施例を適用した装置の基本構成図であり、第2 図は第1 図中の結体1 の斜視図である。第2 図の通り、 法体1 は例えば石英ガラス製の基板1 1 を有し、 この話板1 1 の中央部には平面形状が四辺形の凹部1 2 が形成されている。凹部1 2 の対向する側壁には一対の電極1 3 a , 1 3 b が例えばブラチナ(Pt) で形成され、これにはリード線1 4 a , 1 4 b が接続されている。この基板1 1 の凹部1 2 には細胞1 6 を含む媒液1 7 が所定量だけ入れられ、第1 図のようにセットされる。

すなわち、第1図に示すように、リード線 14a. 14bは直流パルス電源2に接続され、 これによって媒被17に直流パルス電場が印加さ れるようになっている。細胞16の状態は光学顕 微鏡3により観察され、かつレーザ光源4からの レーザピームL、が光学顕微鏡3を介して媒被

成および修復が共に遅くなる。そこで、第3図中の記号LAで示す部分にのみレーザ光を照射し、この部分を加熱した状態で直流パルス電場を印加すると、レーザ光加熱された部分LA中の細胞部分P1の小孔は開状態となっている合計時間が相対的に 短くなる。その結果、加熱されていない細胞部分 P2の小孔は開状態となっている合計時間が相対的に 足くなる。その結果、加熱されていない細胞部分 P2の小孔を介して、媒液17中のDNAがより多く取り込まれることになる。

DNAの具体的な取り込み手順としては、次のようなものがある。

まず、代気穿孔されるのは直流パルス電場の電気力線方向端部の細胞膜であるので、DNAを収り込むべき収込部を上記直流パルス電場の電気力線方向に位置決めする。この具体的方法としては、例えば基体1を光学顕微鏡3で観察しながら回転、移動させればよい。また、例えば高周波電場を印加することで公知のパールチェーン現象を生起させ、細胞16を特定方向に向けるようにしてもよ

L.

ز

次に、上記のような加熱条件下で、直流パルス 電場を印加して電気穿孔する。この直流パルス電 場は1~数μsecのパルス幅、1~数secの パルス間隔で数回行なう。なお、直流パルス電場 の印加タイミングとレーザ光の照射タイミングに

次に、本発明者による具体的な実施例を説明する。

まず、一辺が1cmで深さが3mの凹部を中央に 形成した石英ガラス板を用意し、この凹部に第2 とのような電極対を白金(Pl)で形成可変を して、電極対には電圧およびパルス幅がした。で ルス石英ガラスからなる基板の下方には白色光光を お向きせた。をといれて、イン・サビーム照射できるよりに となっトし、レーザビーム照射できる実験を行なった。 たった。

#### 実施例1

海水と略同一濃度のショ糖水溶液を1回用意し、この中に生きたウニの卵を50個程度入れ試料液とした。次に、この試料液を石英ガラス板の凹部に1~2mの深さになるまで垂らし、顕微鏡で確認して処理対象のウニの卵を選び出した。次に、

ついては、細胞膜の形成あるいは移復過程で選択的に加熱できるものであれば、いかなるタイミングであってもよい。以上のようにして電気穿孔すると、媒液17に含まれたDNAが細胞16中に 選択的に取り込まれることになる。

スポット径が5μmのArレーザピームを選び出した細胞の一方の側のみにスキャンして照射し、パルス幅が5μsec、パルス間隔が1.0secの直流パルス電場を、1.5KV/cmの弦さで10回印加した。その結果、加熱されていないウニの卵の細胞部分には加熱された部分に対して5倍の量で、ショ糖水溶液中のDNAが取り込まれた。

#### 比較例1

実施例1において、Ar レーザビームの照射以外を全く同一条件にして、DNAの取込実験を行なった。その結果、DNAの取込量は直流パルス 電場の電気力線方向において略同一であった。

### 実施例2

人間の血液と略同一濃度のショ糖水溶液を1 ml 用意し、この中に生きた赤血球を5 0 個程度入れ 試料液とした。次に、この試料液を石英ガラス板の凹部に1~2 mmの深さになるまで垂らし、顕微位で確認して処理対象の赤血球を6 個だけ選び出した。次に、スポット径が5 μmのAr レーザビ

ームを選び出した 6 個の知路のうちの 4 個のみにスキャンして照射し、パルス幅が 1 . 5 μ s e c 、パルス間隔が 1 . 0 s e c の直流パルス電場を、1 . 5 V / cm の強さで 1 0 回印加した。その結果、加熱されていない 2 個の赤血球には加熱された 4 個の赤血球に対して 5 倍の量で、ショ糖水溶液中の D N A が収り込まれた。

#### 比較例2

٠ ﴿

実施例1において、Arレーザビームの照射以外を全く向一条件にして、DNAの取込実験を行なった。その結果、DNAの取込量は6個の途血球において略同一であった。

#### (発明の効果)

以上、詳細に説明した通り本発明では、、媒液中の1個の細胞の特定の部位、もしくは複数の細胞中の特定の細胞のみが選択的に加熱され、この条件下で直流パルス電場による電気穿孔がなされるので、加熱されていない細胞の特定の部位もしくは特定の細胞の細胞膜の小孔は遅く修復されることになり、ここから長い時間にわたってDNA

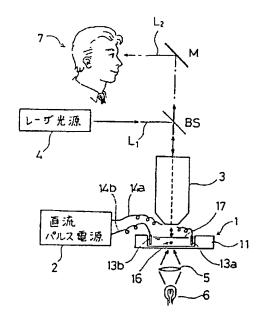
などが取り込まれることになる。このため、細胞の特定の部位もしくは特定の細胞にDNAを選択的に取り込むことが可能になる。

#### 4. 図面の簡単な説明

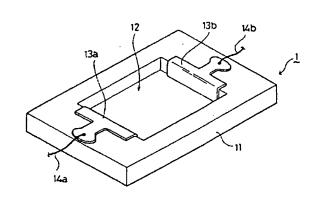
第1 図は、本売明の実施例に係る細胞電気穿孔 装置の基本構成図、第2 図は、第1 図に示す基体 の斜視図、第3 図は、実施例の作用を説明する図、 第4 図は、実施例による D N A の取り込み例を説 明する図である。

1 … 基体、 1 2 … 凹部、 1 3 a . 1 3 b … 社極、 2 … 直流パルス電源、 3 … 光学顕微鏡、 4 … レーザ光源、 5 … リレーレンズ、 6 … 白色光源、 7 … 複名者

特許出願人 浜松ホトニクス株式会社 代理人弁理士 長 谷川 芳 樹

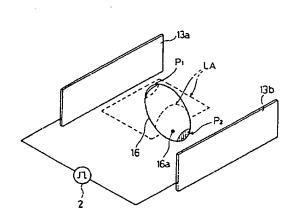


実施例に係る装置の基本構成 第1図

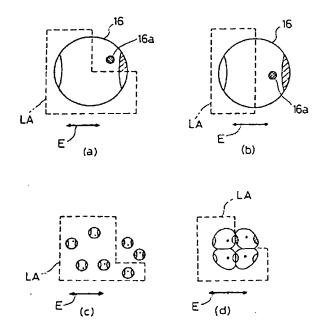


第1図の基体の針複図 第2図

# 特別平2-131585(6)



実施例の作用を放明する図 第3図



実施例によるDNAの取り込み例 第4図